16 B 422 (13 F 111)

特許 庁

特許 公報

特許出願公告 昭 44-5366 公告 昭44.3.6 (全3頁)

1,4 プタンジオールの製造方法

願 昭 41-49631

出願日 昭 41.7.30

発明者 森田右穂

特

名古屋市港区船見町1の1東亜合

成化学工業株式会社研究所内

同 広小路和久

同所

同 岩井禧典

同所

同 伊藤博夫

同所

出 願 人 東亜合成化学工業株式会社

東京都港区西新橋1の14の1

代表者 伊知地寧次郎

発明の詳細な説明

本発明はアープチロラクトンから1,4プタンジオールを製造する方法に関するものであり、さらに詳しくは本発明はアープチロラクトンを銅クロム系触媒の存在下に水素で接触還元を行つて高収率で1,4プタンジオールを製造する方法に関するものである。

本発明者は1・4 ブタンジオールの有利な製造方法につき各種研究を行い現在工業的に安価に大量に製造されている アーブチロラクトンより高収率で、純度の高い1,4 ブタンジオールを製造せんとし種々研究を重ねた結果銅、クロム系の触媒をアープチロラクトンに対し1~20 wt%使用し、所望によりアルコール、エーテル、飽和炭化水素、水等の溶媒を使用し200℃付近で水素分圧を50~200atmに保ち約1~2時間接触還元を行うことにより仕込原料アーブチロラクトンに対し反応率90~100(モル)%、反応消費アープチロラクトンに対し90~98(モル)%の高い選択率で1.4ブタンジオールを得ることを見出し本発明を完成した。

本発明方法では触媒として銅クロム系の触媒を使用するが具体的には銅とクロムまたは銅とクロム酸化物、あるいはクロムと銅酸化物、または銅酸化物とクロム酸化物、さらには銅クロム酸アンモニウム塩を分解して得られるCuOとCuOr2O4と

より成る銅クロム酸化物または特許 M200077 のごとき方法で得られる銅クロム酸化物等が使用される。また、溶媒は使用しない方が蒸留精製が容易であるが、反応熱除去、希釈剤、触媒分離促進の目的で添加した方が望ましくまた反応速度、収率も高くなる。使用する溶媒はアープチロシを地で、クトンならびに1.4プタンジオールと相溶性があるかまたはなく、またこれ等と沸点の差が大きさがまたはなく、またこれ等と沸点の差が大きされずと消費せず、触媒や原料、生成物を変質でルカンまたはなりのアルカンのが好適で例えば炭素数が1~4のアルカンテルコール、パラフィン系またはシクロアルカンに水素、ジエチルエーテル、ジプロビルオンテル、アルキレングリコール、水、シクロアルカノール等が用いられる。

本発明に使用される アープチロラクトンは高純 度に精製されたものである必要はなく、触媒毒と なる硫黄化合物や大量の有機酸、無機酸を含有し ていない限り、他の不純物が混在している粗アー プチロラクトン液でも使用しうる。

例えば無水マレイン酸を水素添加して得た未精 製の粗Tープチロラクトン液やコハク酸半アルデ ヒトを水添して得た粗ァープチロラクトン液も全 く同様に本発明方法の原料として使用しうる。高 い反応速度ならびに高い選択率で7ープチロラク トンから1,4プタンジオールを製造するための 最適条件は原料アープチロラクトンの種類、触媒 の種類と量、溶媒の有無および種類によつて異な るが、水添温度は200℃±20℃、水素分圧 50~200atm、水添時間は1~2時間の範囲 がよく、反応速度をより一層上げんとして、さら に高温高圧の激しい条件で行うとアープチロラク トンの変質や過水素添加が起き一部はテトラヒド ロフラン等にまで水添されて目的物たる1,4プ タンジオールの収率が低下する。以下実施例を用 いて発明の内容をさらに詳しく説明する。

なお、実施例に記載された%は特に規定のない 限りモル%を示す。

実施例 1

内容積 1 ℓ のステンレス製横振り振盥式オートクレープに市販試薬級の ℓ ープチロラクトン(純度 98.8%) 879、メタノール 2609、日揮化学製銅クロマイト触媒 $N-203\cdot 17.29$ を

Best Available Copy

仕込み水素ガスを初圧70atmで圧入した後振盪しながら、加熱し200℃に達した時、水素を追加してオートクレープ内圧を150atm(水素分圧約115atm)とし、水素添加が進み内圧が140atmに降下する度に水素を追加圧入しながら、200℃で、1.5時間水添を行つた。しかるのち、オートクレープを水で冷却、残余の水素ガスを放出し水添生成液361g(触媒を含む)を得た。

これを静置して触媒沈降分離後、上澄液をガス クロマトグラフィーで分析した結果本例における 未反応アープチロラクトンは 4.1 3 g (0.0 4 8 **

※モル)で1,4プタンジオールは82.2g(0.913 モル)で1,4プタンジオール生成率は91.3% であつた。

実施例 2

実施例1のメタノールの代りに溶媒として表 -1のものを用い、日揮化学製銅クロマト触媒N -203を1-プチロラクトンに対し20wt% 使用し水素分圧115atm、反応温度200℃で 1.5時間接触還元し次のような結果を得た。

なお、溶媒の量は r ープチロラクトンに対する wt比である。

表 - 1

溶媒の種類	溶媒の量	アープチロラクト ン反応率(%)	1 . 4 プタンジオール選択率(%)
エタノール	4	9 6.7	9 3.6
シクロヘキサン	4	9 0.0	8 4.5
テトラヒドロフラン	4	8 8.5	9 4.3
1 ープロパノール	3.1	9 2.8	9 4.0
ジプロピルエーテル	3.0	9 3.7	9 3.6
エチレングリコール・	3.0	9 0.5	9 2.3
なし	_	8 6.5	8 3.8

注 触媒N-203は特許200077号の方法で製造されたもの。

実施例 3

実施例1と同じ反応装置を用い、アープチロラ ただし、自然 クトン(純度 9 8.8%)のメタノール溶液(溶媒/ 水素分圧165 アープチロラクトンwt比=4)を触媒の種類、 なお、触媒量量を変えて、水素分圧115atm、200℃で & wt%である。

№1.5時間接触還元し次のような結果を得た。

ただし、自家製触媒の場合は、溶媒を使用せず、 水素分圧165atm220℃で反応を行つた。 なお、触媒量は、アープチロラクトンに対する wt%である。

表 - 2

触媒の種類	触媒量	アープチロラク トン反応率(%)	1 , 4 ブタンジオ ール選択率(%)
日揮化学銅クロマイトN-203	2 0	9 5.2	9 5.9
"	1 0	9 0.6	9 6.1
"	1	7 8.3	9 3.2
自家製触媒 注1)	5.7	9 4.5	8 5.2
ラネーニツケル	1	2 4.7	5.8
日揮化学安定化ニツケル	1	. 2 6.3	4.0

ドラジウムーアスペスト (パラジウムとして)	0.2	1 6.5	1 2.5

注1) アドキンス法に従い、クロム酸銅アンモンを熱分解して製造した触媒

実施例 4

日揮化学製銅クロマイト触媒N-203を触媒と して溶媒にメタノールを、原料には純度98.8%のアープ チロラクトンを使用した場合の水添温度、水添圧力、 あり、触媒量は ۲ープチロラクトンに対し20 水添時間とアープチロラクトンの反応率ならびに※ wt%である。

※1.4プタンジオールの選択率との関係は以下に 示す通りであつた。

なお、溶媒/٢ープチロラクトンwt比は4で

表 - 3

水添圧力		L 75 VE2		アープチロラク	1,4プタンジ
オートクレ ープ内圧 atm	水素分圧 atm	水添温度 ℃	水瘀時間 hr	トン反応率 %	オール選択率 %
4 5	1 0	200	1.5	2 0.0	4 3.0
5 5	2 0	"	"	2 8.7	8 0.1
9 5	6 0	"	"	5 5.8	9 0.5
1 5 0	115	"	"	9 5.2	9 5.9
200	1 6 5	"	"	100	9 8.8
150	1 4 0	100	"	1 7.5	2 0.0
"	1 3 0	150	"	5 2.2	6 1.1
"	1 1 0	2 2 0	"	9 8.8	9 6.3
"	9 5	250	"	1 0 0	8 2.8
"	1 1 5	200	0.5	5 5.1	9 6.2
"	"	"	1.0	7 8.2	9 7.5
"	"	"	1.5	9 5.2	9 5.9
	"	"	2.0	9 7.4	9 3.8
"	"	"	3.0	9 9.0	9 1.4

特許請求の範囲

1 アープチロラクトンを水素ガスで加熱、加圧 下で接触還元するに当たり、銅クロム系触媒を用 いることを特徴とする1,4プタンジオールの製 造方法。

引用文献

公 昭39-4461 Chemical Abstwacs Vol 62. Na 4 3 9 2 0